# 電子工学11

津山工業高等専門学校 情報工学科 講師電気通信大学 先進理工学科 協力研究員藤田一寿

## MOS構造

- MOSとは
  - Metal(金属), Oxide(酸化物), Semiconductor(半導体)
- ・金属、酸化物、半導体が層状に構成されている.

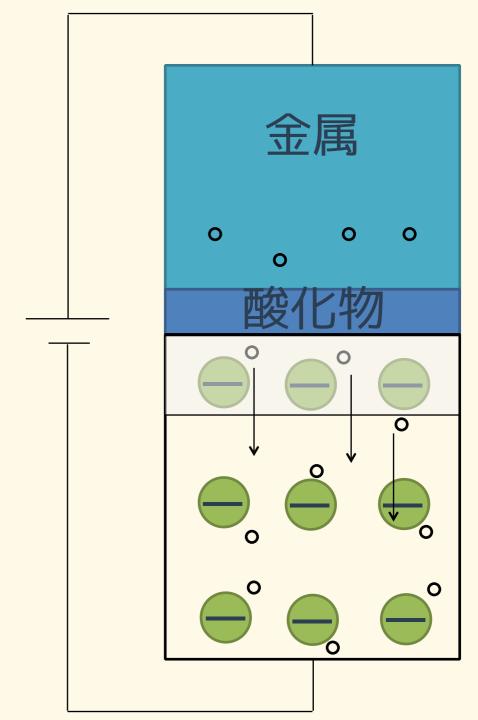
金属

酸化物

半導体

## MOS構造の性質

MOSに図のように電圧をかけると金属がプラスの電荷がたまる.p型半導体の正孔は反発して接合面とははない方向に移動する.接合面には空乏層ができる

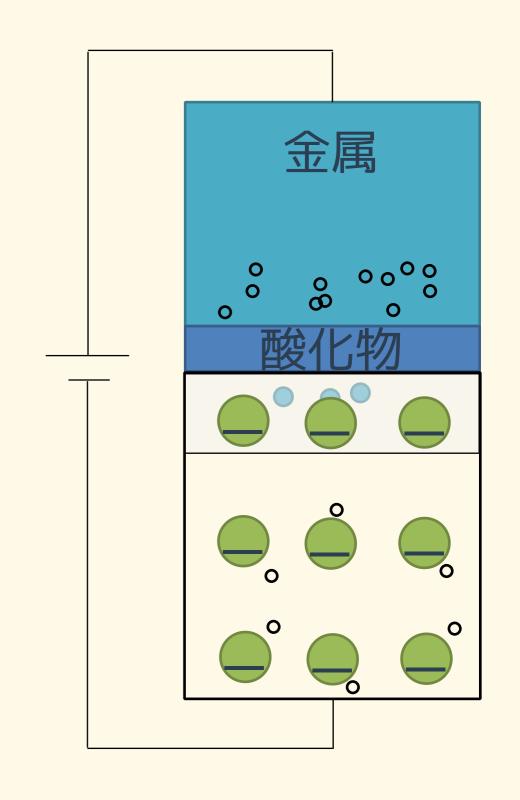


空乏層

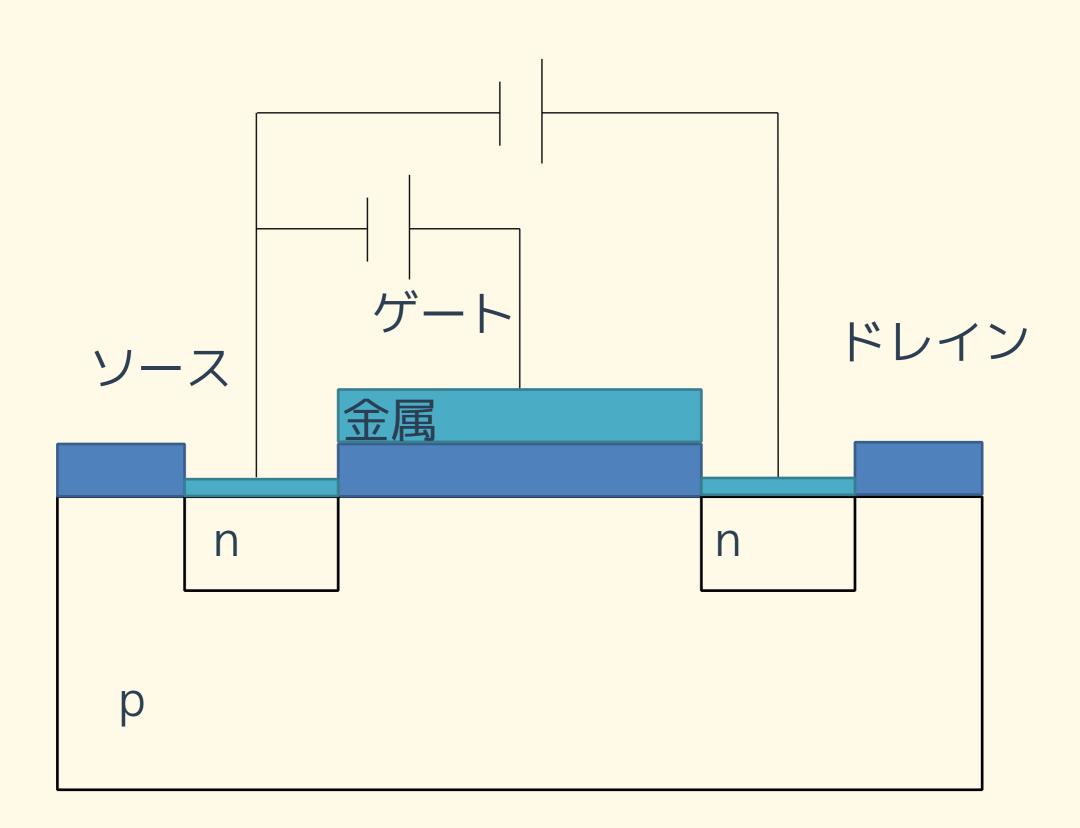
## MOS構造の性質

さらに強い電圧をかけると, p型半導体内にわずかにあった自由電子が接合面付近に集まる. 集まった自由電子はキャリアとしては接合付近で働く.

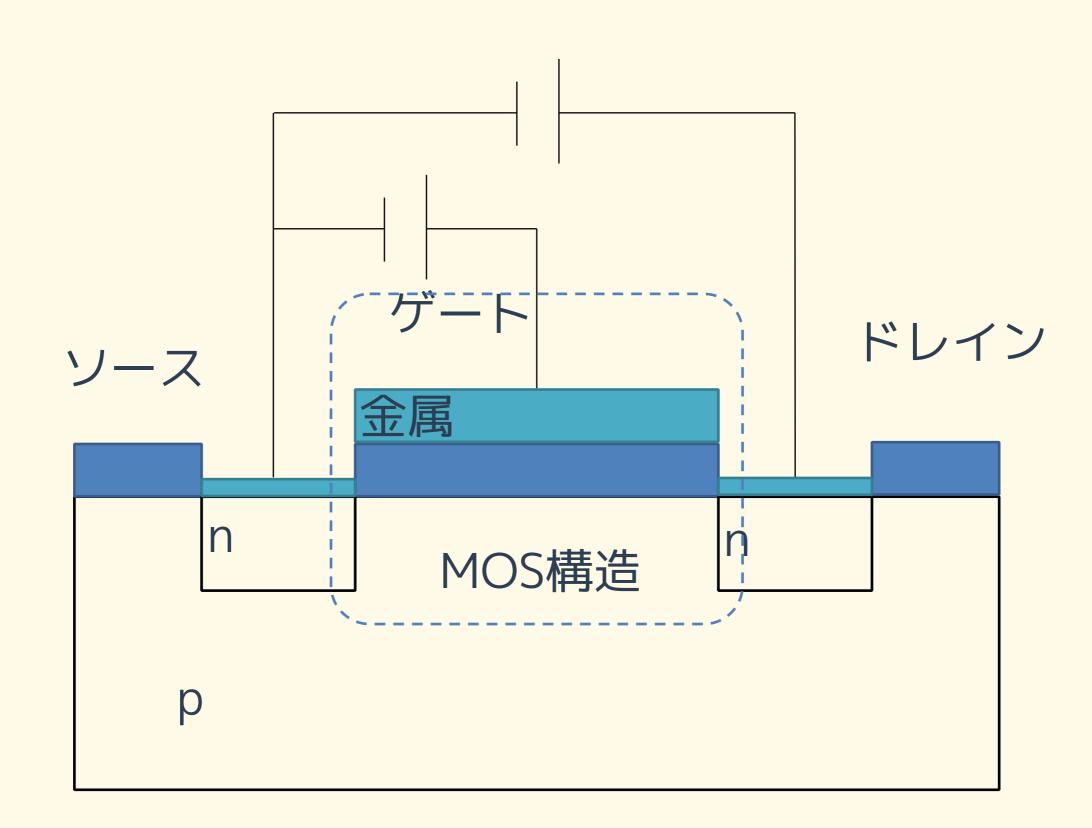
接合面に電子が集り、その電子がキャリアになる。接合面付近ではあたかもn型半導体のように振る舞う。これをn型反転層という。



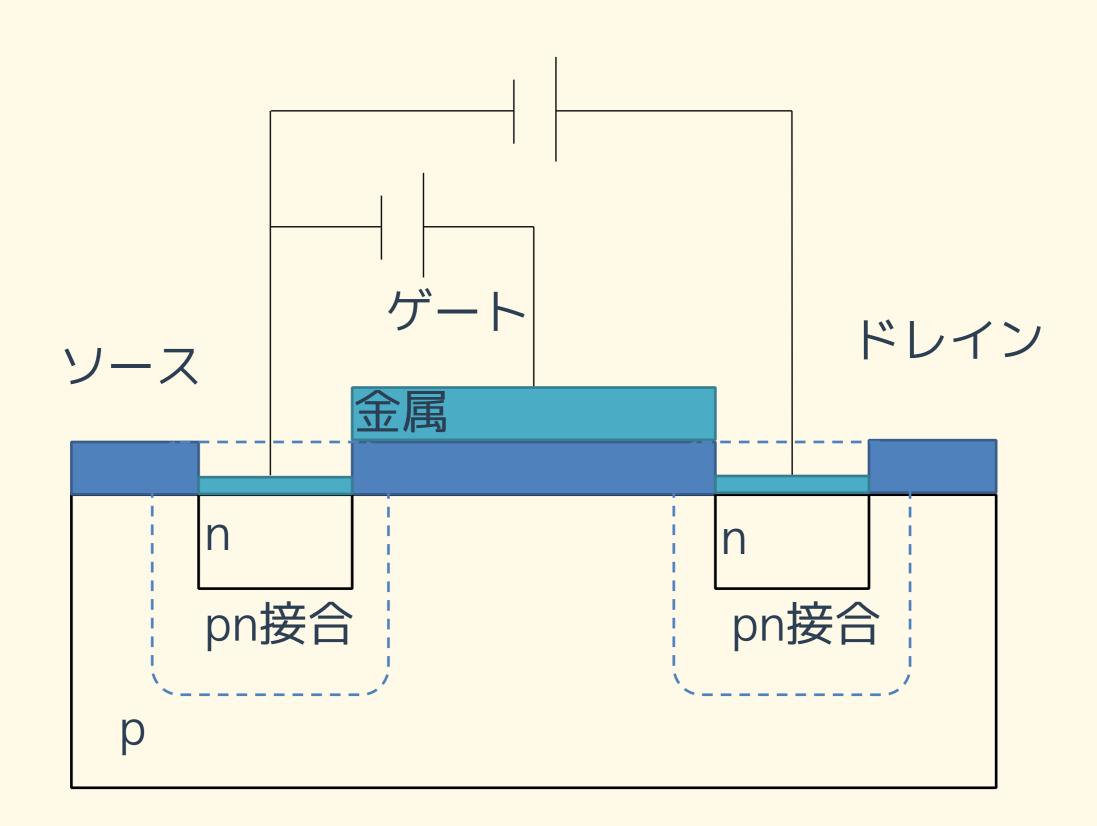
## MOSFETの構造

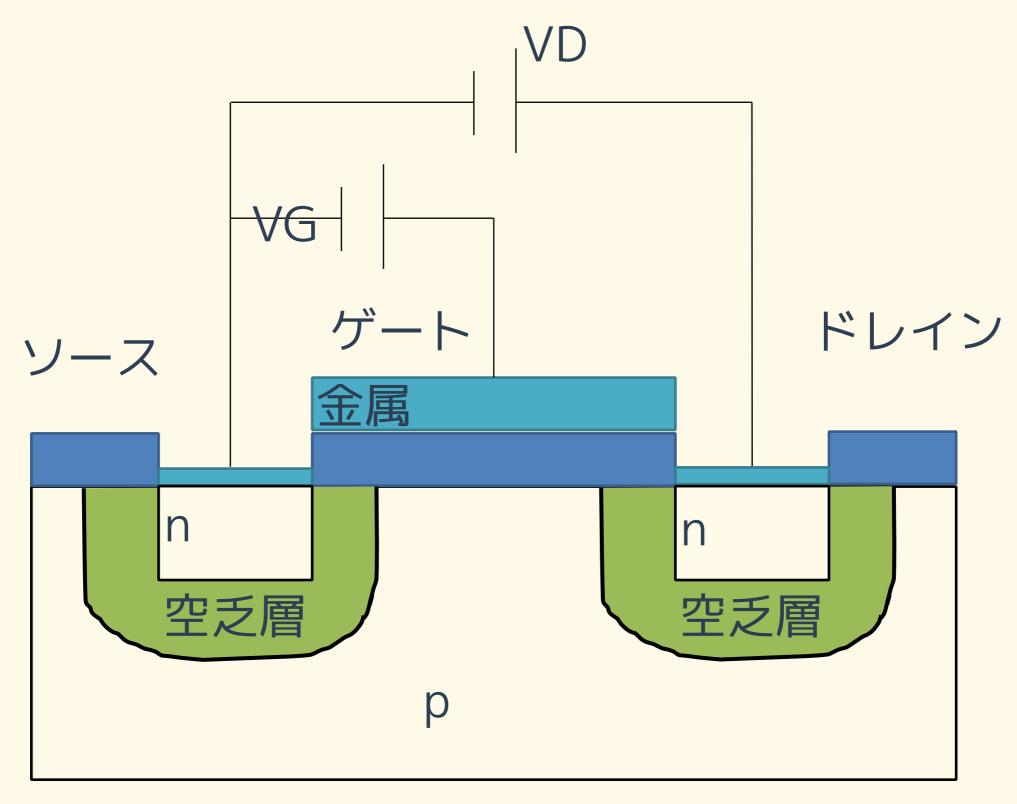


## MOSFETの構造



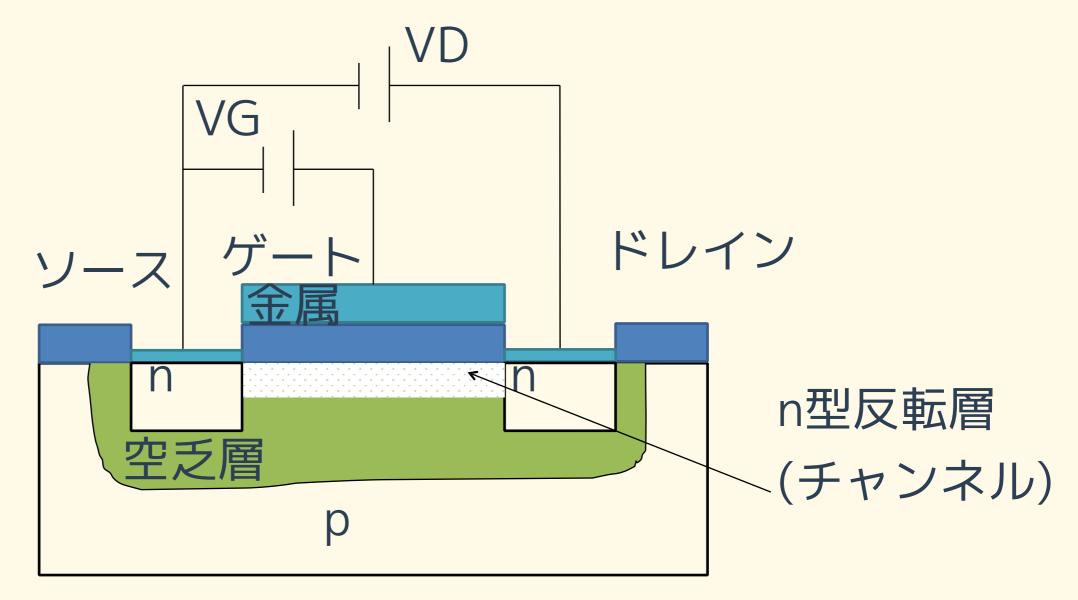
# MOSFETの構造





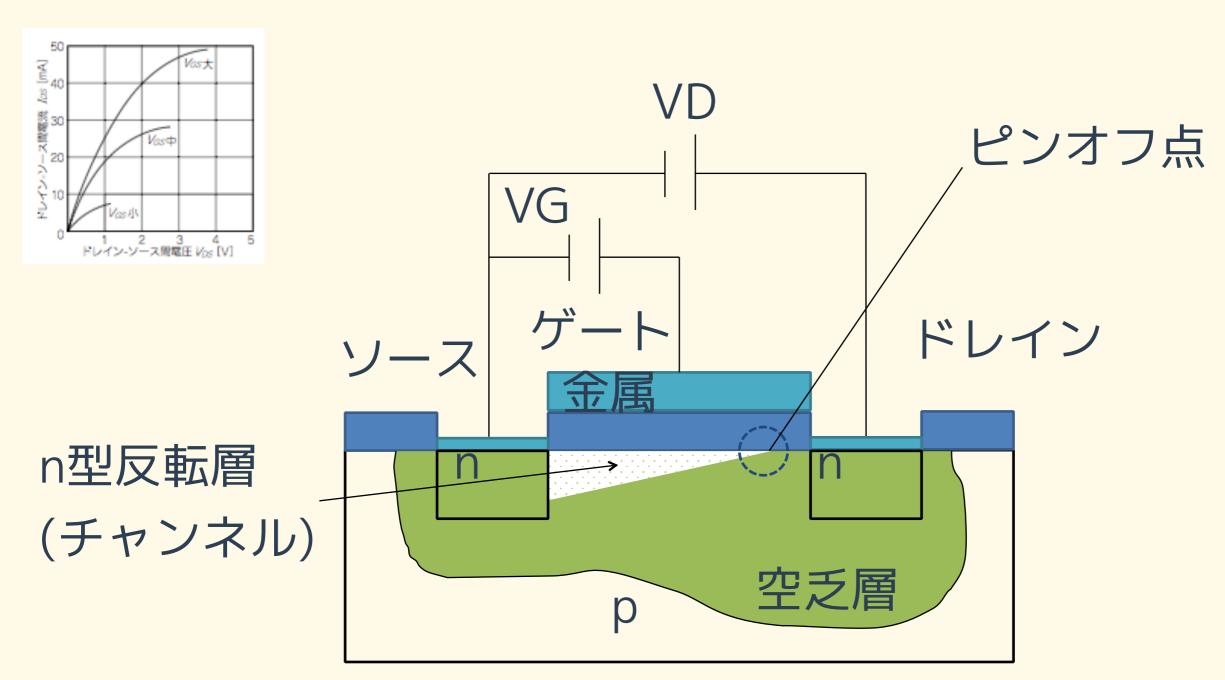
接合面には空乏層ができる

#### VG>>VD



電圧をかけるとMOS接合している場所では、n型反転層ができる. 反転層がソースとドレインの接続することで、ソースドレイン間の電流が流れる. N型反転層が流れを通す役割をするので、この反転層はチャンネルと呼ばれる.

#### VG<VD



ソースドレイン間により強い電圧をかける と,反転層の自由電子がプラス側に吸収さ れ,プラス極側の反転層がなくなっていく.